MPI TS200-SE | ShielDEnvironment™付 200 mmマニュアル・プローバー

広温度範囲 DC/CV、RF測定用マニュアル・プローバー

顕微鏡マウントおよび移動機構
- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- リニアZリフト (構成変更が容易に)
- 50×50 mm XYリニア機構

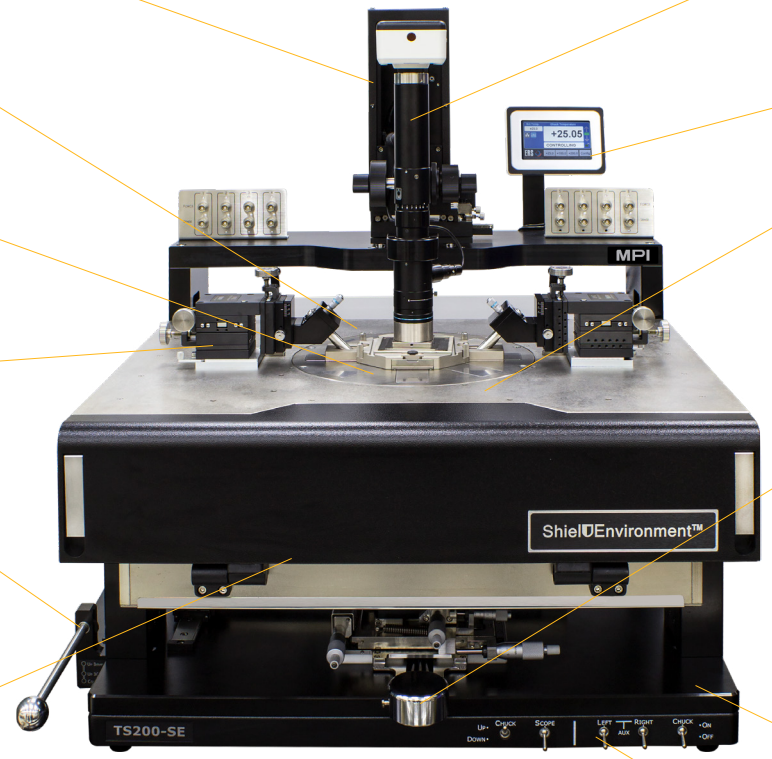
プローブ・プラテン
- 高剛性、安定設計
- RFポジショナ用角型調整器
- エアークーリング内蔵プラテンで熱安定設計

RFキャリブレーション
- 校正基板用2つの補助チャック
- 高精度な校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 µm (高コンタクト精度)

DCおよびRFポジショナ
- 最大RF 4台またはDC 8台まで搭載可能
- さまざまなポジショナより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビン、RFアームのラインアップ

独自のプラテンリフト
- コンタクト、コンタクト・セパレーション(300 µm)、ロード(3 mm)の3つの独立したポジショニング
- セーフティー・ロック機能±1 µmの再現性をもつ高コンタクト精度「オート・コンタクト」

ShielDEnvironment™
- EMIシールド、遮光環境により、超低ノイズ・低キャパシタンス測定を実現
- 広い前面ドアよりIC/ウェハーの出し入れ、ShielDCap™
- 常時シールドされた状態で、構成変更が簡単
- RF4ポートまたはDC/ケルビン8ポートまで測定が可能
- プローブ・カード仕様もご用意
- 結露防止対策用 前面ドア自動ロック機能



顕微鏡および顕微鏡オプション
- さまざまな顕微鏡より選定可能
- MPI単眼鏡筒SZ10/MZ12(12倍ズーム、作動距離95 mm)
- パソコンいらずのHDMI接続差端子付きCCDカメラ

温度チャックインテグレーション
- タッチスクリーンによる完全制御
- 温度制御、操作が簡単

モジューラー式チャック
- さまざまな常温、温度チャック
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- 300℃までの各種温度範囲より選定可能
- フィールドにてアップグレード可能
- センター(小さな被測定物)、小ウェハーとの切替が簡単

ケルビン・インタフェース
- ｹﾙﾋﾞﾝ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽｵﾌﾟｼｮﾝ)をご用意(ｹｰﾌﾞﾙまわしが容易に)

チャック XY/θステージ機構
- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 225 x 260 mm XYステージ移動範囲
- < 1.0 µm 精度 @ 500 µm/解像度
- 20 mm空気圧リフトによるウエハーのロード/アンロード
- 5 mm高精細Z軸精度 (< 1.0 µm @ 500 µm/解像度)
- ±5° θ微調整機構
- ロードが簡単な広いY軸設計

小型な設計
- 作業台におけるベース・プレート
- 振動吸収アブソーバ・ベース
- 省スペース設計

真空制御を前面に設置
- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記

オプション
- 防振台
- 真空ポンプ/エア・コンプレッサ
- 作業台 (温度コントローラ用ラック、パソコン、キーボード・トレイ付)
  ※ｵﾌﾟｼｮﾝにてﾃﾞｭｱﾙ・ﾓﾆﾀ・ｽﾀﾝﾄﾞ、計測器ﾄﾚｲが取付可能)